簡約化 MHD コードを用いた乱流粒子流束解析 Analysis of turbulent particle flux by using reduced MHD code

轟晴彦¹, 糟谷直宏^{1,2}, 矢木雅敏³ TODOROKI Haruhiko¹, KASUYA Naohiro^{1,2}, YAGI Masatoshi³

¹九大総理工,²九大応力研,³量研機構 ¹IGSES, Kyushu Univ., ²RIAM, Kyushu Univ., ³QST

核融合プラズマにおいて, 高密度プラズマを 維持する目的でペレットによる粒子供給が行 われている. 炉心プラズマ中心近傍にまで粒子 を供給するには、有効な粒子ピンチ効果の機構 を理解することが必要である. イオン温度勾配 不安定性が粒子ピンチ効果を持つことが理論 的に知られている[1]. さらに密度勾配を反転さ せると電子系の不安定性も内向き粒子ピンチ を励起可能であることが指摘されている[2]. 局 所モデルに限定されることなく、グローバルモ デルにおいても有効な輸送機構が必要である. そこで,5 場簡約化磁気流体モデルを用いたグ ローバルシミュレーションで乱流粒子流束の 評価を行っている. ここではペレット入射直後 のプラズマ端近傍に密度こぶ状分布がある状 態のシミュレーションを行い,密度勾配が反転 した領域での粒子対流輸送の向きと大きさを 評価する.

シミュレーションには簡約 MHD コード R5F を使用する. 電位, ベクトルポテンシャル, 磁 力線方向流速, 密度, 電子温度の 5 場を, 渦度 方程式, オームの法則, 磁力線方向のイオン運 動方程式、連続の式、電子温度の発展方程式を 用いて空間3次元的に時間発展を解く[3]. モデ ル方程式は長さを小半径,時間をポロイダルア ルフベン時間で規格化している.トカマクプラ ズマ計算パラメータは以下のものを使用する: 大半径R = 1.5 m, 小半径a = 0.5 m, プラズマ ベータβ = 10⁻², 逆アスペクト比ε = 0.33, 規 格化されたイオンのスキン長 $\delta = 10^{-2}$,抵抗率 $\eta_{\perp} = 10^{-3}, \ \eta_{\parallel} = 10^{-5}, \ \text{Mittike} \ \chi_{e\perp} = 10^{-5},$ $\chi_{e\parallel} = 10.0$,新古典粘性係数 $\mu_e = 1.39 \times 10^{-3}$, $\mu_i = 4.65 \times 10^{-5}, \ \alpha_T = 0.71.$ 径方向位置 $r = r_s$ に密度ソースピーク(密度強度 Samp)を初期状 態に導入したシミュレーションを行う(図 1). r = rs近傍の径方向内側に密度勾配が正の領域 が存在する. ここではこの領域を反転勾配と呼 ぶ.対して通常の密度勾配負の領域を通常勾配 と呼ぶ. R5F コードを用いて電子ドリフト波不 安定性の時間発展を計算する.安全係数分布に 対応してr。= 0.8の時, 通常, 反転勾配領域で共 鳴するモードとしてそれぞれ例えば(m, n) = (- 25,8), (-36,14)がある(図 1). ここで m, n はそれ ぞれポロイダル,トロイダルモード数である. 弱磁場側に局在するバルーニング構造を持つ 線形不安定性が励起される.

線形段階におけるモード構造から不安定性 が誘起する粒子ピンチの強さと径方向範囲を 評価した(図 2).通常勾配領域で強く励起される *n*=8モードが全体として支配的であり、その 駆動する外向きの粒子流束が卓越している.一 方で反転勾配領域では小さいながらも内向き の粒子流束が生じている.

初期密度分布の勾配強度を $S_{amp} = 1.0$ 及び 1.5,勾配位置を $r_s = 0.7$ 及び0.8とした場合の比 較を行った.密度強度が大きい場合,反転勾配 領域でモードが不安定化し,そして内向きの粒 子流束割合が増大していることが確認された (図 2). 講演では非線形状態における粒子流束 解析結果についても報告する.



図1 初期密度分布. S_{amp} = 1.0及び1.5の場合と 安全係数分布を示す.



図 2 S_{amp} = (a)1.0及び(b)1.5の場合の径方向 粒子流束分布.線形段階のもので,正の値が径 方向外向きに対応する.

[1] B. Coppi and C. Spight, Phys. Rev. Lett. **41** ,551 (1978).

- [2] M. Yagi, et al, Proc. BPSI Meeting (2018) 2-1.
- [3] C. T. Hsu, *et al*, Phys. Fluids, **29**, 1480 (1986).